

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 1 月 18 日 (2007.1.18)

【公表番号】特表 2002-532838 (P2002-532838A)
 【公表日】平成 14 年 10 月 2 日 (2002.10.2)
 【出願番号】特願 2000-587588 (P2000-587588)
 【国際特許分類】

H 0 5 H 1/42 (2006.01)

H 0 1 J 37/32 (2006.01)

【F I】

H 0 5 H 1/42

H 0 1 J 37/32

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 11 月 10 日 (2006.11.10)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】請求項 1
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【請求項 1】 少なくとも 1 つの高周波源 (1 5) と、少なくとも 1 つのガス入り口開口 (1 0) および少なくとも 1 つのビーム出口開口 (1 3) を備えた、電磁放射に対して透過性の中空体 (1 1)、特に管とを有する低温フリープラズマビーム (2 1) を発生する装置であって、高周波プラズマソース (1 5) が中空体 (1 1) の内部に低温プラズマを発生する形式のものにおいて、作業室 (1 9) が設けられており、該作業室内部に、中空体 (1 1) 内で生成した低温プラズマ (1 2) を低温フリープラズマビーム (2 1) としてビーム出口開口 (1 3 , 1 3 ') を介して中空体 (1 1) から入射させかつそこで収束させて導くことを特徴とする、低温フリープラズマビームを発生する装置。